(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202438489 U
(45)授权公告日 2012.09.19

(21)申请号 201220078015.6

(22)申请日 2012.03.01

(73)专利权人 扬州荣德新能源科技有限公司
地址 225131 江苏省扬州市扬子江南路 9 号出口加工区
专利权人 无锡尚德太阳能电力有限公司

(72)发明人 胡建波 鄢康 袁聪

(51)Int.Cl.
B08B 3/10(2006.01)

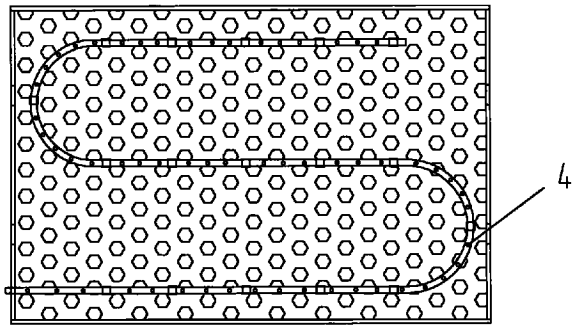
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种溢流漂洗花篮

(57)摘要

本实用新型公开了一种溢流漂洗花篮，该溢流漂洗花篮包括篮体和管道，篮体四周设有孔洞，管道设置在篮体侧面，并向篮体底部延伸，于篮体底部固定，管道在篮体底部的部分开设有若干气孔。本实用新型可以大大缩短漂洗硅料或其他待漂洗不规则固体的周期，提高生产效率，并可实现纯水的多次利用。



CN 202438489 U

1. 一种溢流漂洗花篮，其特征在于：包括篮体和管道，所述篮体四周设有孔洞，所述管道设置在篮体侧面，并向篮体底部延伸，于篮体底部固定，所述管道在篮体底部的部分开设有若干气孔。

2. 根据权利要求 1 所述的溢流漂洗花篮，其特征在于：所述孔洞的直径为 2.5mm，孔洞之间的间距为 2.5mm。

3. 根据权利要求 1 所述的溢流漂洗花篮，其特征在于：所述管道在篮体底部的部分呈“S”型。

4. 根据权利要求 1 或 3 所述的溢流漂洗花篮，其特征在于：所述管道的直径为 8mm。

一种溢流漂洗花篮

技术领域

[0001] 本实用新型涉及太阳电池的硅片切割领域，特别涉及清洗硅料的一种溢流漂洗花篮。

背景技术

[0002] 在太阳电池的硅片切割，尤其是硅料与其他待漂洗不规则固体的溢流鼓泡漂洗过程中，由于硅原料及回收料经过化学品处理后，表面附着大量残留的化学品，需要经过大量纯水漂洗，由于大部分硅料是不规则形状，而且体积较小，需要使用大量的纯水，经过长期漂洗，而且漂洗期间需要人工不间断的搅拌，防止硅料漂洗不够充分。由于硅料形状不规则，而且在漂洗过程中，是将硅料直接倾倒在漂洗槽中，只经过一次漂洗，而且漂洗完毕后需要将漂洗槽内纯水排放干净，才能将硅料取出，从而导致在硅料漂洗过程中耗费大量纯水，而且生产效率较低，漂洗周期较长一直是硅料清洗的瓶颈，并且不能充分实现纯水多次利用。

发明内容

[0003] 本实用新型提供一种溢流漂洗花篮。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种溢流漂洗花篮，包括篮体和管道，所述篮体四周设有孔洞，所述管道设置在篮体侧面，并向篮体底部延伸，于篮体底部固定，所述管道在篮体底部的部分开设有若干气孔。

[0005] 作为优选地，所述孔洞的直径为 2.5mm，所述孔洞之间的间距为 2.5mm。

[0006] 作为优选地，所述管道在篮体底部的部分呈“S”型。

[0007] 作为优选地，所述管道的直径为 8mm。

[0008] 由于上述技术方案运用，本实用新型与现有技术相比具有下列优点：

[0009] 1、由于本实用新型增加了可以产生气泡管道，漂洗时可以起到充分搅拌漂洗的作用，加大了漂洗力度，缩短了漂洗周期，可以有效提高漂洗产能。

[0010] 2、由于本实用新型由于在篮体上开设了孔洞，所以每次漂洗完毕后只需将此溢流漂洗花篮取出后再去除硅料，漂洗槽中的纯水可以多次利用。

附图说明

[0011] 附图 1 为本实用新型的溢流漂洗花篮的主视图；

[0012] 附图 2 为本实用新型的溢流漂洗花篮的侧视图；

[0013] 附图 3 为本实用新型的溢流漂洗花篮的俯视图。

[0014] 以上附图中：1、篮体；2、管道；3、孔洞；4、气孔；

具体实施方式

[0015] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述：

[0016] 实施例一：参见附图 1 所示，一种溢流漂洗花篮，包括篮体 1 和管道 2，所述篮体四周设有孔洞 3，孔洞的直径为 2.5mm，孔洞之间的间距为 2.5mm，篮体内外的纯水可以通过这些孔洞进行交换，每次漂洗完毕后只需将此溢流漂洗花篮取出后再去除硅料，使漂洗槽中的纯水可以多次利用。所述管道 2 设置在篮体侧面，并向篮体底部延伸，在篮体 1 的底部焊接固定。参见附图 2 所示，管道 2 在篮体底部的部分呈“S”型，并开设有若干气孔 4。管道 2 的直径为 8mm。当气泵通气入所述管道 2 内时，管道上的气孔 4 产生气泡，利于对篮体内的待清洗的硅片进行鼓泡清洗。

[0017] 上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

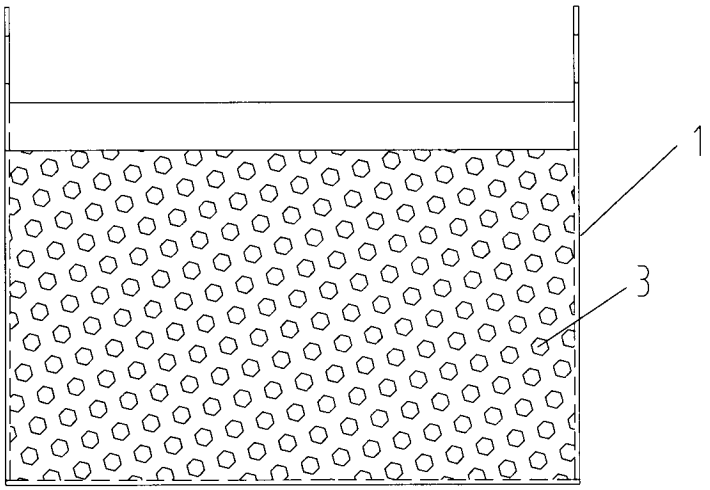


图 1

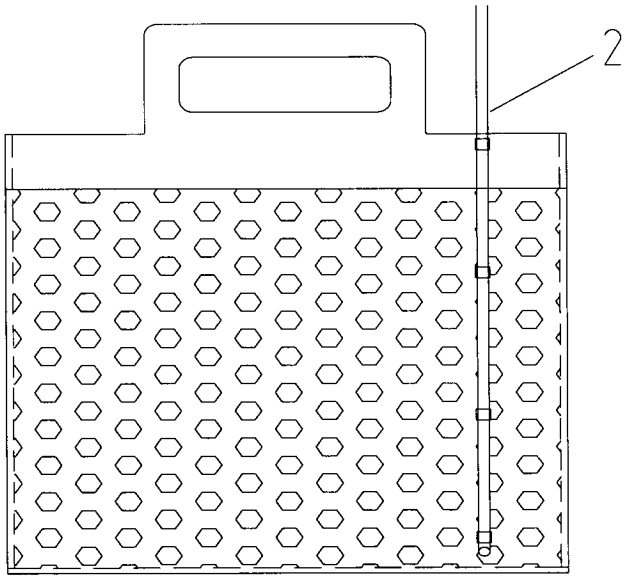


图 2

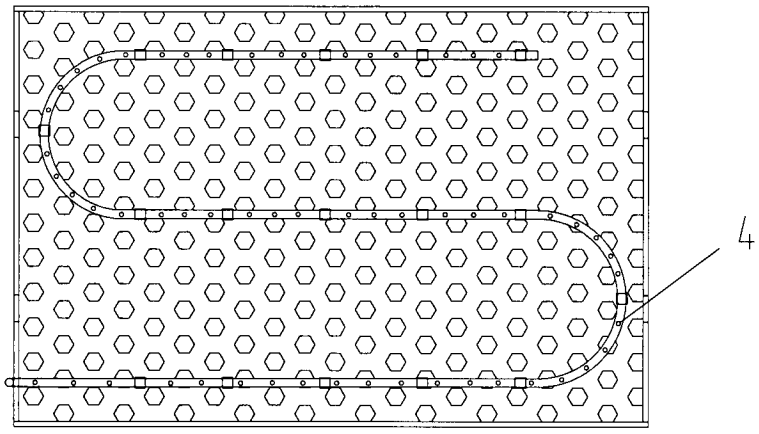


图 3